SUWA SEIKOSHA KK

15 9030-730-A

16.08.82-JP-141818 (18.02.84) CO1b-33/12 CO3b-20 CO3c-03/06

Quartz glass prodn. by sol-gel orocess - effecting hydrolysis of alkoxy-silane whilst cooling with ice to suppress exothermic reaction of eless than 10 deg. C

C84-057393

Improvement comprises effecting the hydrolysis of alkoxysilane whilst cooling with ice to suppress exothermic reaction at temps. of less than 10 deg. C and to prevent local polymerisation reaction, so that quartz glass of high uniformity and transparency is obtd. The hydrolysis is effected by adding H2O to ethyi ortho-silicate in molar ratio (H2O)/(Si(OC2H5)4) of 5-15 as follows:

nSi(OC2H5)4 + 4nH2O = nSi(OH)4 + 4nC2H5OH(1)

nSi(OH)4 = nSiO2 + 2nH2O(2)

Aq. dil. HCI soln. may be used to accelerate the hydrolysis reaction. In order to obtain transparent lumpy glass having no porosity, it is desirable to carry-out slow crosslinking reaction afte-cormation of a net-like skelton and to finally form a quartz structure. For this purpose, it is necessary to cease the hydrolysis reaction (1), stably maintaining resultant tetrahydroxysilane, and subsequently controlling the polymerisation reaction so that this is uniformly and slowly carried-out. (2pp Dwg.No.0/0)

① 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59-30730

Mint. Cl.3	識別記号	庁内整理番号	④公開 昭和59年(1984)2月18日
C 03 C 3/06		6674—4G	
C 01 B 33/12		7310-4G	発明の数 1
C 03 B 20/00		7344-4G	審査請求 未請求
C 03 C 3/30	101	6674-4G	
			(全 2 百)

❸石英ガラスの製造法

②特 願 昭57-141818

②出 願 昭57(1982)8月16日

@発 明 者 宮下悟

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

@発 明 者 神戸貞男

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舍内

⑩発 明 者 土岐元幸

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

⑩発 明 者 竹内哲彦

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

⑪出 願 人 株式会社諏訪精工舎

東京都中央区銀座4丁目3番4

号

邳代 理 人 弁理士 最上務

明 知

発明の名称

石英ガラスの製造法

特許額求の範囲

ソルーゲル 法を用いて石英ガラスを製造する際、アルコキシシランの加水分解を氷冷下で行なうことにより発熱を1 0 で以下におさえて局在的な重合反応を防ぎ、均一度・透明度を高めることを特徴とした石英ガラスの製造法。

発明の詳細な説明

本発明はアルコキシシランの加水分解を低温で 行なうことにより達成される、均一度・透明度の 高い石英ガラスの製造法に関する。

ソルーゲル法は金属アルコキシドを加水分解し、ゲル化させ得られた乾燥ゲルを加熱する非溶酸ガラス製造法である。金属アルコキシドを出発原料とすると原料精製が容易であり、溶散法で作る

ことが困難な組成でも均質なガラスを比較的低温で作ることができる。溶散法により石英ガラスを作製する場合、原料の調整が困難なうえ純度も低く 1 7 0 0 ~ 2 0 6 0 ℃の高温を必要とするが、 ゾルーゲル法を用いると 1 0 0 0 ℃以下でガラス 化が起こり石英ガラスが得られる。

アルコキシランの加水分解は溶錐としてアルコールを加え均一系で行なう方法と、アルコールを加えが水と二層のまま激しく提拌する。均一系で行なうたとがある。均一系で行なうたとがある。均一系で行なうたとがある。均であり、反応終了ないため要であり、反応終了、といるの収縮率が大きいため割れやゆがみを生したが、プルコールを用いず不均一系で行なう方が実用的といえる。

不均一系での加水分解は室温において 1 0 分ほどで終了するが発熱し、薄く白濁したコロイド溶液となる。ゲル化乾燥の後得られた乾燥ゲルも白色で、1000℃以下の熱処理では解消できない

• したがって均質であり、比較的低温で石英ガラスが得られることなどのゾルーゲル法の利点を満たしていない。

本発明はかかる欠点を除去したものでアルコキシシランの加水分解を氷冷下で行うことにより、 局在的な重合反応を防ぎ、 均一度の非常に高い透明なゾルから出発して石英ガラスを製造すること を目的とした。

以下実験例に基づいて本発明を詳しく説明する

現在塊状石英ガラスをゾルーゲル法で製造する場合、オルトケイ酸エチルに対し、水をモル比で [Hz 0]/(81(00 = Hs)4]が5~15となる条件で加水分解が行なわれている。 反応式は(1)式及び(2)式で示される。

 $n81(00_2H_8)_4+4nH_80 \rightarrow n81(0H)_4+4n0_2H_80H$

.....(1)

S1 (OH)4 → # S102 +2 # H2 O

水の量が5倍モル以下だと充分に加水分解せず その乾燥ゲルをその後高温に加熱しても風化して

均一かつ徐々に重合が遠むよう制御しなければな ちない。

合成石英ガラスをセル等の光学器機に用いる場合、透過率は非常に重要な問題である。 ソルーゲル は 化学合成法であるゆえ非常に高純度の石英ガラスが得られ、 従来より光学特性が良くなることが期待できる。 そのためには加水分解時における粒子生成を防ぎ、重合反応を均質に進めることが必要である。

以上のように本発明は透明度の高い均質な石英

透明になりにくい。また 1 5 倍モル以上の量の 水は無意味であり、ゲル化時間を遅らせるため 不要である。

溶媒としてエタノールを加えずに 2 層のまま 室温にて厳しく提押すると、発熱して単一層になるが、わずかに白濁したコロイド溶液となる。な お加水分解反応を促進するために希塩酸水溶液を 用いる。

白濁するのは加水分解の時発生する熱により 重合反応が促進され、②式あるいは脱アルコール 重合(3)式によりケイ酸微粒子が大量に生成したた めである。

 $S1(0H)(00_2H_8)_2 + S1(00_2H_8)_4 \rightarrow S1(00_2H_8)_3$ -0-S1(00_2H_8)_3+0_2H_80H

気孔のない透明塊状ガラスを得るには網目状の 骨格ができた後、徐々に架橋が進み、最終的に石 英精造をとることが望ましい。そのためには(1) 式 の加水分解反応を完全に終了させ、生成するデ え ラヒドロキシシランを一度安定に保ち、然る後に

ガラスを製造するために非常に有効である。

K F

出願人 株式会社課助精工會 代理人 弁理士 最上